

Установка травления фотошаблонов Mask Etcher

Установка травления фотошаблонов Mask Etcher

Производитель:

Plasma-Therm

Цена:

Цена по запросу

Описание

Plasma-Therm Mask Etcher — это установка, специально предназначенная для производства фотошаблонов высокого разрешения. Установка использует технологию индуктивно-связанной плазмы и позволяет получать элементы с топологическим размером менее 22 нм. Благодаря особой конструкции, Mask Etcher обладает набором уникальных технологических преимуществ, необходимых при производстве фотошаблонов:

- Сохранение высокой степени чистоты камеры на протяжении всего срока эксплуатации.
- Быстрое восстановление после чистки.
- Стабильность параметров процесса не зависит от длительности эксплуатации.

Ключевые преимущества установки Mask Etcher:

- Контроль равномерности процесса травления.
- Производство фотошаблонов с наименьшим сдвигом минимального размера.
- Высокая воспроизводимость результатов.
- Высокая степень чистоты в камере.
- Малое краевое размытие рисунка.
- Возможность работы с такими материалами, как Cr, MoSi, кварц.

Основные технические характеристики установки Mask Etcher

Размер электрода	От 11" до 15,6" в диаметре
Загрузка	Автоматизированная загрузочная станция (ALS) Открыватель контейнера SMIF с буферной зоной

Система контроля	На базе ControlWorks
Вакуумный насос	Турбомолекулярный насос 1200 л/с
Газовые линии	До 8 каналов с цифровыми РРГ
Система отслеживания окончания процесса (на базе EndPointWorks)	Оптический эмиссионный интерферометр (OEI) Лазерный рефлектометр (LES)
ВЧ-генератор	ICP: 2000 Вт, 2 МГц
Варианты установки	Через стенку ЧПП
Электропитание	380 В, 50 Гц, 3 фазы
Сертификация	CE, SEMI-S2, S8